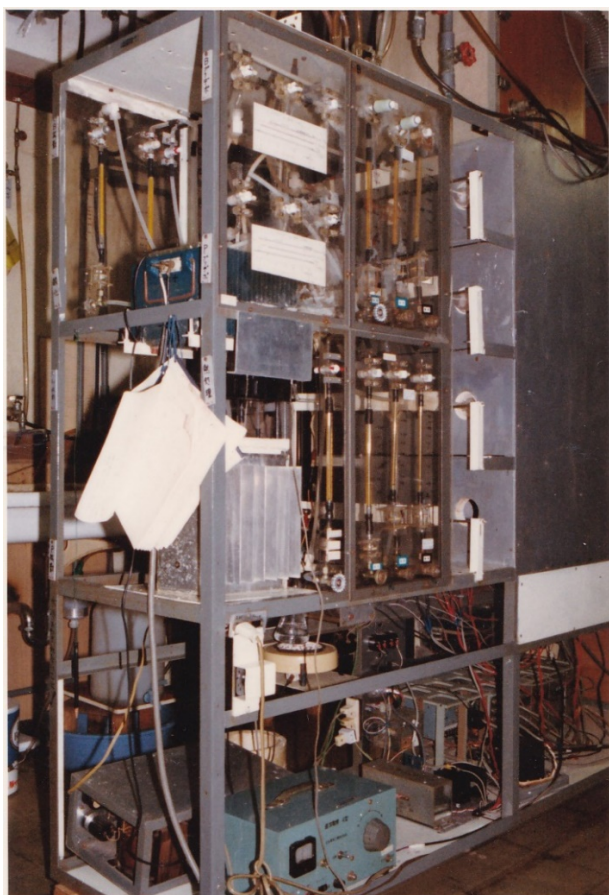
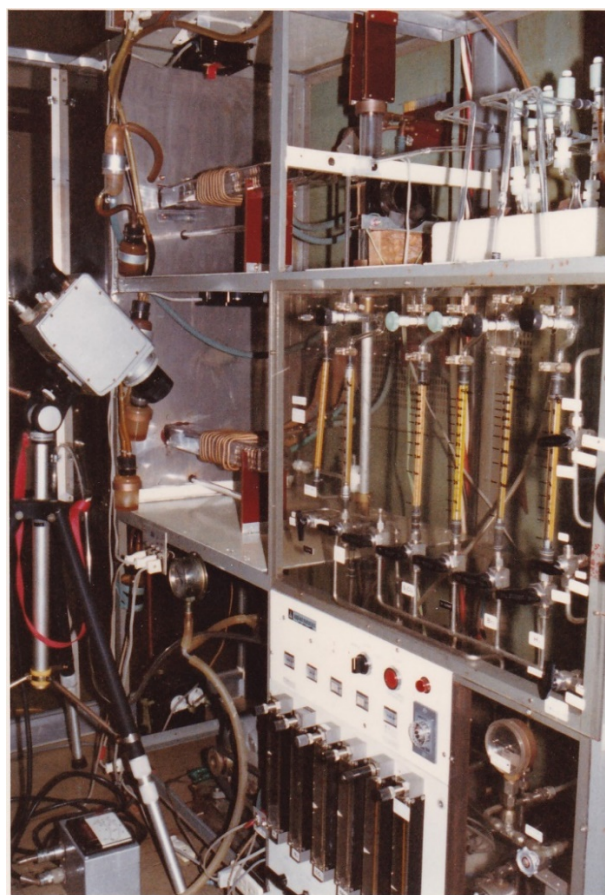


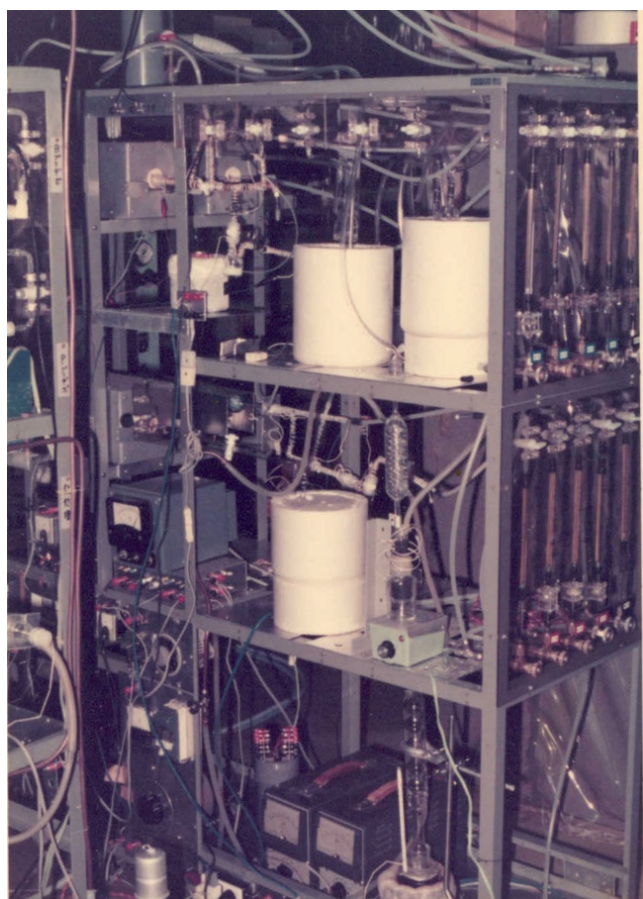
5 ウェハプロセス (2) (酸化・拡散、CVD)



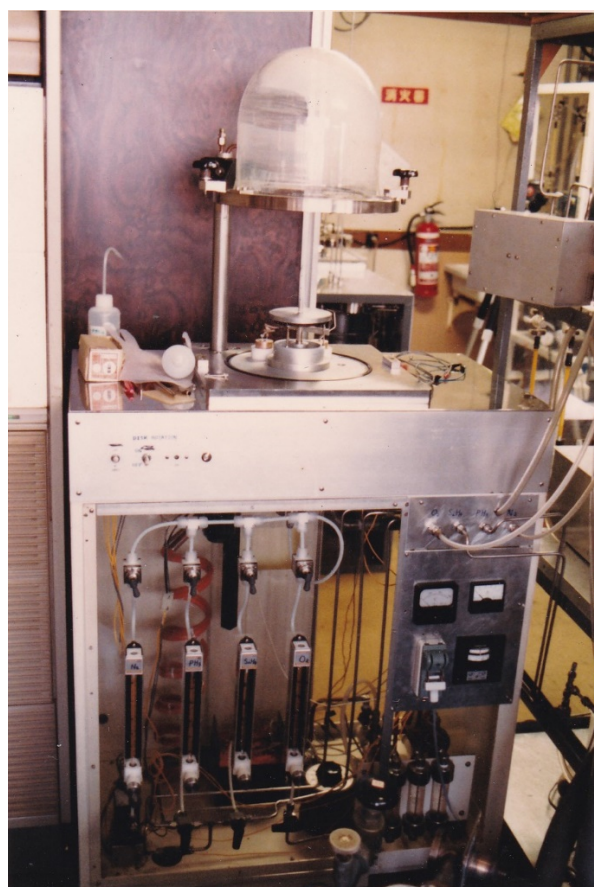
酸化拡散炉



RF 加熱常圧 CVD 炉 (Si_3N_4 、 SiO_2 、Poly-Si) (現物展示)



TEOS (テトラエトキシシラン)ソース Al_2O_3 - SiO_2 CVD 炉



SiO_2 用 低温 CVD 炉